

SPEAKER

MI Tutorial 2025



조종희 TL
SK hynix

Biography

'조종희'는 SK하이닉스에서 Memory 반도체의 DRAM과 NAND 제품 개발을 위한 계측 기술을 개발해 왔습니다. 현재 그는 SK하이닉스 DRAM 제품의 요소기술 ~ N+3 Tech 개발을 위한 MI 핵심계측 기술 개발 파트장 역할을 수행하고 있습니다.

2022년부터 SK하이닉스 내부 학술대회 심사 위원을 역임했으며, e-Beam 장비 및 Optic 장비를 이용한 구조 분석에 특화된 핵심계측기술을 전문적으로 개발하고 있습니다.

2025년 - 현재 SK하이닉스 DRAM MI개발 팀 Metrology 파트장

2022년 - 현재 SK하이닉스 학술대회 MI분과 학술 심사위원

2022년 - SK하이닉스 R&D MI 팀 e-Beam Metrology 파트장

2018년 - SK하이닉스 R&D MI 팀 입사

2018년 - KAIST 물리학과 석/박사 졸업

Abstract

본 Tutorial 강의에서는 반도체 제조 공정에서의 계측(Metrology) 기본 원리와 활용 방법을 체계적으로 설명합니다. 광학, e-Beam(CD-SEM, HV-SEM) 등 주요 계측 장비의 측정 원리와 특성, 선택 기준을 다룹니다. 또한 Pattern Profile 분석, Overlay 분석 등 주요 계측 응용 사례를 소개하여, 전반적인 반도체 계측 공정에 대한 이해도를 높입니다. 또한, 차세대 반도체 공정에서 준비해야 할 차세대 미래 계측 과제와 대응 전략을 해설합니다.